

($T_M \approx 165$ К) обусловлен конкуренцией рассеяния дырок на статических дефектах и колебаниях решетки, а наблюдаемый при $T > 210$ К закон $I''(U) \sim T^{2.2}$ можно связать в таком случае с доминирующим рассеянием дырок на колебаниях решетки.

Приводимые здесь результаты указывают на необходимость учета обнаруженной анизотропии токопереноса дырок для оптимизации параметров фотопреобразователей на основе одноосных полупроводников $\text{Al}_2\text{V}_1\text{Sc}_2$.

В заключение авторы благодарят В.Д. Прочухана за любезное предоставление кристаллов.

Список литературы

- [1] Полупроводники $\text{A}_2\text{B}_4\text{C}_5$ / Под ред. Н.А. Горюновой, Ю.А. Валова, М.: Советское радио. 1974. 376 с.
- [2] Shay J.L., Wernick J.H. *Ternary chalcopyrite semiconductors*. Oxford: Pergamon Press. 1975. 340 p.
- [3] Абдурахимов А.А., Рудь Ю.В. // Изв. вузов, Физика. 1985. № 12. С. 93–96.
- [4] Рудь Ю.В. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 12. С. 2208–2211.
- [5] Rudd V.Yu., Rudd Yu.V., Sergienko M., Tairov M.A. // Phys. stat. sol. (a). 1989. V. 113. N 2. P. 207–213.
- [6] Губанов А.И. // ФТП. 1985. Т. 19. В. 6. С. 1145–1147.
- [7] Борисенко С.И. // Канд. дис. Томск: Госуниверситет. 1986. 136 с.
- [8] Борщевский А.С., Овэзов К., Рудь Ю.В. // Кристаллография. 1977. Т. 22. В. 1. С. 202–208.
- [9] Най Дж. Физические свойства кристаллов. М., 1960. 386 с.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе АН СССР,
Ленинград

Поступило в Редакцию
8 августа 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 21

12 ноября 1990 г.

06.1; 06.2

© 1990

РЕЗОНАНСНОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ДВУХБАРЬЕРНОЙ СТРУКТУРЕ НА ОСНОВЕ $\text{GaAs}-\text{AlAs}$

В.Н. Луцкий, Б.К. Медведев,
В.Г. Мокерев, А.С. Рылик,
Ю.В. Слепцов, С.С. Шмелев,
В.С. Шубин

Одной из наиболее актуальных проблем твердотельной электроники в настоящее время является изучение резонансного туннелирования. Исследование этого явления начато работами [1–3].

Рис. 1. Примеры вольтамперных характеристик структуры при различных температурах (площадь структуры: а) $S = 150 \times 150 \text{ мкм}^2$; в) и с) $S = 250 \times 250 \text{ мкм}^2$).

В настоящем сообщении излагаются результаты работы по созданию и исследованию двухбарьерной структуры со сверхтонкой (4 нм) квантовой ямой, на которой наблюдалось резонансное туннелирование электронов.

Исследуемая структура получена методом молекулярно-лучевой эпитаксии в сверхвысоком вакууме. Структура выращена на полуизолирующей подложке GaAs диаметром 60 мм и представляет собой следующую последовательность слоев:

$i\text{GaAs}$ (0.6 мм) - $n^+\text{GaAs}$ ($1.5 \cdot 10^3$ нм; $2.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$) - $i\text{GaAs}$ (14 нм) -

- AlAs (2 нм) - GaAs (4 нм) - AlAs (2 нм) - $i\text{GaAs}$ (1.5 нм) -
- $n\text{GaAs}$ (0.5 · 10^3 нм; $1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$) - $n^+\text{GaAs}$ (50 нм; $2.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$)

Активная часть структуры выделена чертой.

Формирование отдельных диодов (на основе мезаструктур) осуществлялось путем химического травления. Диаметр структур варьировался от 100 до 500 мкм. Контакты к n^+ области формировались с использованием AuGeNi . Наблюдалась высокая однородность параметров исследуемых диодов по всей площади шайбы, что является существенным технологическим достижением, особенно для структур со столь тонкой ямой.

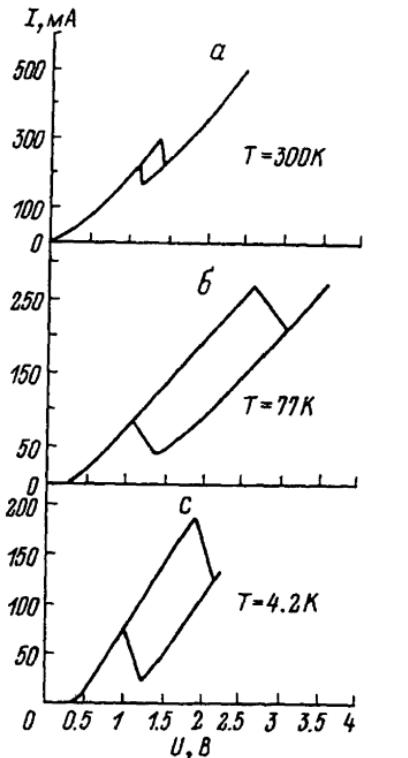
На рис. 1 приведены примеры вольтамперных характеристик (ВАХ) структуры при 300, 78 и 4.2 К. Основные особенности ВАХ:

1) Наличие начального участка, характеризующегося слабым изменением тока, связанного с обычным (нерезонансным) туннелированием.

2) Наличие области значительного изменения тока, обусловленного резонансным туннелированием. Напряжение, при котором наблюдается изменение скорости роста тока, увеличивается при понижении температуры.

3) Наличие резкого скачка тока („перехода“), интерпретируемого как включение (выключение) резонансного туннелирования. Отношения максимального и минимального токов I_{max}/I_{min} составляют 1.9, 7.0 и 8.0 соответственно при 300, 78 и 4.2 К.

4) Наличие гистерезиса. Гистерезис обусловлен влиянием по-



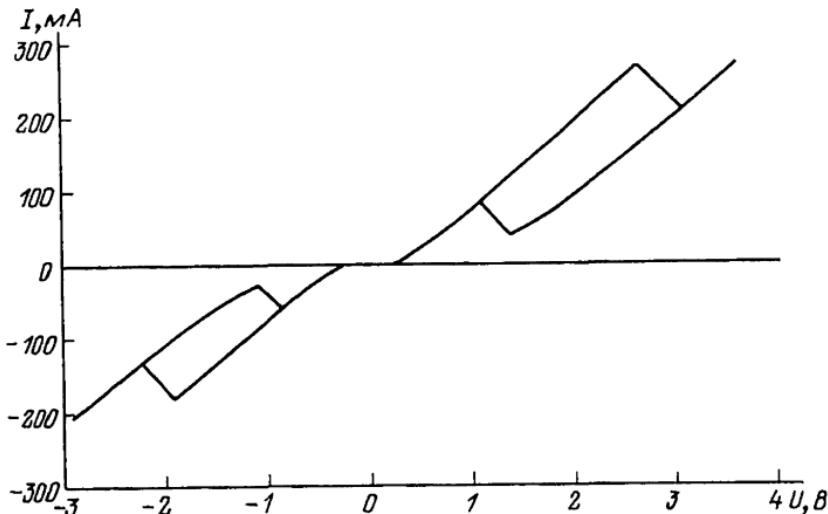


Рис. 2. Пример асимметрии гистерезиса вольтамперных характеристик ($T = 78 \text{ K}$, $S = 250 \times 250 \text{ мкм}^2$).

следовательного балластного сопротивления (в структуре).

5) Наличие асимметрии, связанной, по всей видимости, с асимметрией структуры (рис. 2).

Отметим, что величина напряжения, при котором начинается резонансное туннелирование, не зависит от его полярности. Это свидетельствует, по-видимому, о достаточно высокой симметрии барьера *AlAs*. Наблюдаемая же асимметрия напряжений „перехода“, связана, по всей видимости, с разной величиной энергии Ферми (отсчитанной от дна зоны проводимости) во внешних по отношению к барьерам (и прилегающих к ним) областях *GaAs*.

Обсуждаемые структуры исследовались при 4.2 К в перпендикулярном (H_{\perp}) и параллельном ($H_{||}$) плоскости образца магнитном поле напряженностью до 12.5 Тл. Основные результаты этих измерений сводятся к следующему. В поле $H_{||}$ наблюдаются периодические по обратному полю осцилляции $I(H)_{U=\text{const}}$ (U — напряжение на структуре). Фаза и, соответственно, период осцилляций практически неизменны для разных значений U . Монотонная составляющая зависимости сопротивления структуры от $H_{||}$ имеет различный вид для разных U (от практического отсутствия зависимости до кривой с глубоким минимумом, т.е. с участком отрицательного магнитосопротивления).

В поле H_{\perp} осцилляции имеют сложный характер; монотонная часть сопротивления структуры квадратично зависит от H_{\perp} . В перпендикулярном поле наблюдалась также зависимость (рост) напряжения „перехода“ от магнитного поля.

В полном объеме интерпретация полученных экспериментальных данных будет представлена в подробной статье.

Авторы признательны А.А. Акопяну за помощь в проведении исследований.

Список литературы

- [1] Tsu R. // Appl. Phys. Lett. 1973. V. 22. P. 562.
- [2] Chang L.L., Esaki L., Tsu R. // Appl. Phys. Lett. 1974. V. 24. P. 593.
- [3] Sollner T.C.L.Y., Goodhue W.D., Tannewald P.E., Parker C.D., Peck D.D. // Appl. Phys. Lett. 1983. V. 43. P. 588.

Институт радиотехники
и электроники АН СССР,
Москва

Поступило в Редакцию
9 августа 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 21

12 ноября 1990 г.

06.2

© 1990

СТАЦИОНАРНОЕ ЛАВИННОЕ УМНОЖЕНИЕ ФОТОТОКА В СТРУКТУРАХ МЕТАЛЛ - ПРОВОДЯЩИЙ ДИЭЛЕКТРИК - ПОЛУПРОВОДНИК

А.Я. Вуль, А.Т. Дидейкин,
А.И. Косарев

Задача создания фотоприемного элемента для матричного фотодетектора с внутренним усилением фототока остается по-прежнему актуальной. Лавинный механизм усиления фототока является наиболее привлекательным, поскольку позволяет сочетать высокую пороговую чувствительность с высоким быстродействием [1]. Однако до настоящего времени задача создания многоэлементного матричного фотодетектора на основе лавинных фотодиодов (ЛФД) не решена. Многочисленные попытки привели лишь к созданию линейных приборов на основе ЛФД с числом элементов не более 25 [2]. Это связано с тем, что использование лавинного пробоя в р-п переходе для детектирования фотосигнала требует высокой точности стабилизации по величине приложенного напряжения, температуре, приводит к неприемлемому разбросу величин чувствительности отдельных элементов фотодетектора. Средством разрешения этих проблем может быть использование внутренней отрицательной обратной связи при накоплении заряда неосновных носителей в области умножения и стабилизации за счет этого напряженности поля и коэффициента умножения. Подобные условия могут быть реализованы в структурах металл-диэлектрик-полупроводник при приложении к ним им-